

「励起ナノプロセッシングの展望」

日 時：2006年 2月 7日（火） 13:30 ～ 17:30

場 所：和歌山大学システム工学部 A101教室（〒640-8510 和歌山市栄谷930）

JR和歌山駅または南海本線和歌山市駅より和歌山大学行きバスに乗車、終点下車。

詳細は<http://www.wakayama-u.ac.jp/kikaku/map.html>

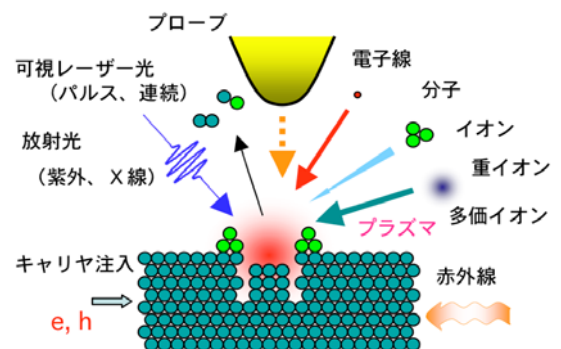
主 催：応用物理学会関西支部

協 賛：応用物理学会新領域「励起ナノプロセス」研究グループ

対 象：大学・企業の研究者、大学院生、学部生

参加費：無料

概 要：物質に光や電子線、イオンビームなどを照射してその構造をナノスケールで改変し新しい物性を創成する試みについて、その基礎を学習するとともに、最新の研究成果をふまえて今後の展望について討論する。



プログラム

司会：和歌山大学システム工学部 伊東千尋、伊藤昌文

(1)13:30 - 14:20 「イントロダクション：励起ナノプロセスとは」

和歌山大学システム工学部 篠塚雄三

(2)14:20 - 15:10 「レーザー光照射による物質改変」

大阪大学産業科学研究所 谷村克己、金崎順一

休 憩

(3)15:30 - 16:20 「電子線照射によるナノプロセス」

大阪大学大学院理学研究科 竹田精治、大野 裕

(4)16:20 - 17:10 「集束イオンビームによるナノプロセス」

兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 松井真二

(5)17:10 - 17:30 「まとめ」

申込方法：氏名、所属、連絡先（住所、電話、FAX、e-mail）を明記の上、2月3日（金）までに以下の宛先あてFAXまたはe-mailにてお申し込み下さい。

問い合わせ先：和歌山大学システム工学部精密物質学科 篠塚雄三

電話: 073-457-8236、FAX: 073-457-8237、e-mail: yuzo@sys.wakayama-u.ac.jp